

УДК 537.226 : 548.55

© 1992

**ИССЛЕДОВАНИЕ УНИПОЛЯРНОСТИ  
НЕОДНОРОДНЫХ КРИСТАЛЛОВ  
ТРИГЛИЦИНСУЛЬФАТА И СЕГНЕТОВОЙ СОЛИ**

*B. B. Михневич, И. Ф. Кацевич*

Анализируется возможность создания стабильного униполярного состояния в сегнетоэлектрических водорасторимых кристаллах путем введения примеси с закономерно-неоднородным распределением ее в объеме кристалла. Исследованы свойства униполярных кристаллов триглицинсульфата (TGS) и сегнетовой соли (RS) с неоднородным распределением примеси: диэлектрическая проницаемость, спонтанная поляризация, внутреннее поле смещения, коэффициент униполярности, пирокоэффициент.

Необходимым условием практического использования сегнетоэлектриков, в частности, в пиро- и пьезотехнике является создание униполярного состояния доменной структуры, стабильного к внешним воздействиям. Решению этой весьма важной задачи — исследованию механизмов, определяющих характер доменной структуры, зависимостей процессов спонтанной поляризации от различных факторов, разработке технологических приемов, позволяющих формировать устойчивое униполярное состояние, — уделяется большое внимание [1-5].

Для формирования униполярного состояния сегнетоэлектриков используют в основном два способа: введение примеси в кристалл [2, 6] и радиационное облучение кристалла [3]. В обоих случаях появление униполярности связывают с возникновением определенных дефектов в кристалле, приводящих к образованию внутренних смещающих полей. Как предполагается в теоретической работе [4] и в экспериментальных исследованиях неоднородной структуры на основе  $\text{LiNbO}_3$  [5], эти поля появляются вследствие несимметричного распределения примеси в процессе роста кристалла.

Представляет интерес исследование влияния примеси, введенной в процессе выращивания кристалла с заранее заданной неоднородностью, т. е. закономерно-неоднородно, на униполярность сегнетоэлектрических водорасторимых кристаллов.

Такие исследования нами проведены на кристаллах триглицинсульфата (TGS) с примесью  $L-\alpha$ -аланина (0.1 мол. %), TGS с примесью ионов  $\text{Cr}^{3+}$  (0.03 мол. %) и сегнетовой соли (RS) с примесью ионов  $\text{Cu}^{2+}$  (0.005 мол. %). Выбор примеси связан с активным внедрением этих ионов в кристаллическую решетку и существенным их влиянием на униполярность исследуемых кристаллов [7, 8].

Для получения закономерно-неоднородного распределения примеси использовался известный факт зависимости вхождения примеси в кристалл от скорости его роста [9]. С этой целью был изготовлен кристаллизатор, в котором периодически изменялась скорость роста кристалла во времени путем изменения гидродинамических условий выращивания по пилообразному закону: сначала

скорость роста медленно возрастала, а затем резко уменьшалась. Период изменения скорости роста кристалла составлял 10 мин, в течение которого вырастал слой кристалла толщиной 40–70 мкм.

Температура в кристаллизаторе поддерживалась с точностью 0.1 °С. Выращивание вели для TGS в течение 72 ч с начальной температурой роста +28 °С и конечной +26.5 °С, для RS в течение 48 ч при снижении температуры с 18 до 17 °С. Одновременно в данном кристаллизаторе, кроме исследуемых

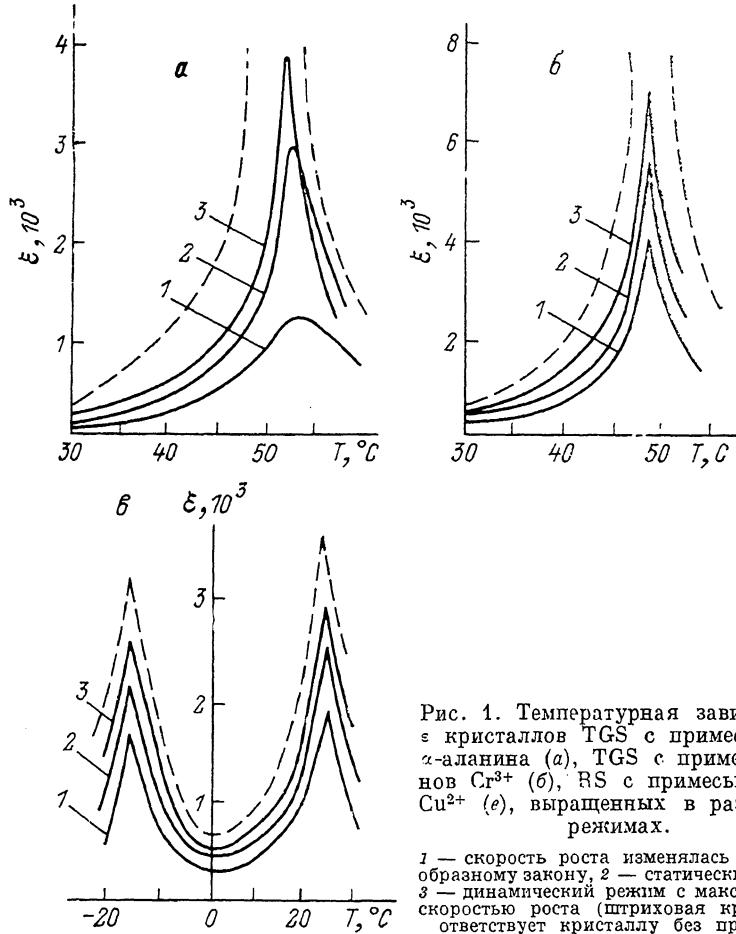


Рис. 1. Температурная зависимость  $\epsilon$  кристаллов TGS с примесью  $L$ — $\alpha$ -аланина (а), TGS с примесью ионов  $\text{Cr}^{3+}$  (б), RS с примесью ионов  $\text{Cu}^{2+}$  (в), выращенных в различных режимах.

1 — скорость роста изменялась по параболическому закону, 2 — статический режим, 3 — динамический режим с максимальной скоростью роста (штриховая кривая соответствует кристаллу без примеси).

кристаллов, растущих с изменяющейся скоростью роста, выращивали контрольные кристаллы: один — с минимальной скоростью, другой — с максимальной скоростью роста.

Было выращено по восемь групп кристаллов TGS с примесью  $L$ — $\alpha$ -аланина и с примесью  $\text{Cr}^{3+}$  (контрольные и исследуемые) и четыре группы RS с  $\text{Cu}^{2+}$ .

Исследованы температурные зависимости диэлектрической проницаемости  $\epsilon$ , спонтанная поляризация  $P_s$ , внутренние поля смещения  $E_{\text{cm}}$ , коэффициент униполярности  $k$  и пирокоэффициент  $\gamma$  полученных кристаллов.

Диэлектрическую проницаемость  $\epsilon$  кристаллов RS в направлении, перпендикулярном плоскости (001), и кристаллов TGS в направлении, перпендикулярном плоскости (010), измеряли мостом E7-8 на образцах толщиной 0.8 мм и площадью  $\sim 10 \text{ mm}^2$  с напыленными алюминиевыми электродами. Скорость изменения температуры 0.2°/мин. Спонтанную поляризацию  $P_s$ , поле смеще-

Таблица 1

Средние значения  $P_s$ ,  $E_{cm}$ ,  $k$  кристаллов TGS и RS с примесями, выращенных в различных режимах

№ п/п	Режим выращивания	$P_s$ , мК $\cdot$ см $^2$			$E_{cm}$ , кВ/см			$k$ , %		
		TGS + $L - \alpha$ -аланин	TGS + Cr $^{3+}$	RS + Cu $^{2+}$	TGS + $L - \alpha$ -аланин	TGS + Cr $^{3+}$	RS + Cu $^{2+}$	TGS + $L - \alpha$ -аланин	TGS + Cr $^{3+}$	RS + Cu $^{2+}$
1	Скорость роста изменилась по пилообразному закону	3.1	2.6	0.15	5.9	3.1	0.85	90	63	20
2	Статический режим	2.85	2.3	0.11	4.8	1.3	0.46	75	50	17
3	Динамический режим с максимальной скоростью роста	2.4	2.2	0.10	3.0	1.0	0.2	65	41	15

ния  $E_{cm}$ , коэффициент унипольярности  $k$  определяли по измерениям петли гистерезиса. Производственные измерения проводили динамическим методом на частоте 20 Гц. В качестве эталонного цироприемника использовали пластинки монодоменного TGS с примесью  $L - \alpha$ -аланина с известными свойствами [6].

Характерный ход кривых зависимостей  $\varepsilon(T)$  кристаллов TGS с неоднородным распределением примеси  $L - \alpha$ -аланина и Cr $^{3+}$  представлен соответственно на рис. 1, а, б (кривые 1). Для сравнения приведены зависимости  $\varepsilon(T)$  для кристаллов, выращенных в статическом режиме (кривые 2) и в динамиче-

Таблица 2

Отношение пирокоэффициентов для кристаллов TGS с примесью, выращенных в различных режимах (1—3) (см. табл. 1)

Номер группы кристалла	TGS + $L - \alpha$ -аланин			Номер группы кристалла	TGS + Cr $^{3+}$		
	1	2	3		1	2	3
1	1.35	1.05	0.95	5	0.89	0.71	0.65
2	1.20	0.95	0.90	6	0.92	0.73	0.70
3	1.40	1.0	0.80	7	0.90	0.70	0.65
4	1.15	0.90	0.08	8	0.85	0.68	0.62

ском с максимальной скоростью роста (кривые 3). Видно, что исследуемые неоднородные кристаллы TGS имеют более пологую кривую  $\varepsilon(T)$  и меньшее значение  $\varepsilon_{max}$ , а  $T_c$  сильнее сдвинута в область высоких температур. Аналогичные зависимости  $\varepsilon(T)$  получены и для кристаллов RS с примесью ионов Cu $^{2+}$  (рис. 1, в).

Наблюдаемые отличия в поведении  $\varepsilon(T)$  кристаллов с неоднородным распределением примеси можно объяснить наличием большого  $E_{cm}$ , которое уменьшает  $\varepsilon_{max}$  и сдвигает  $T_c$  в сторону более высоких температур [10].

В табл. 1 приведены средние значения  $E_{cm}$ ,  $P_s$ , исследованных неоднородных кристаллов и контрольных кристаллов при комнатной температуре, а также коэффициент унипольярности, рассчитанный по формуле [11]

$$k = (S^+ - S^-)/(S^+ + S^-) \cdot 100 \%,$$

где  $S^+$  и  $S^-$  — суммарная площадь положительной и отрицательной компонент доменной структуры.

Из табл. 1 видно, что наибольшее значение  $E_{cm}$ ,  $P_s$  и  $k$  имеют кристаллы с закономерно-неоднородным распределением примеси. Наибольшее влияние неоднородное вхождение примеси в кристалл оказывает на  $E_{cm}$  и  $k$  образцов TGS с примесью  $L-\alpha$ -аланина.

Результаты исследований пироэлектрических свойств кристаллов TGS с примесью  $L-\alpha$ -аланина и  $Cr^{3+}$  показаны в табл. 2 и на рис. 2, где соответственно приведены отношения широкoeffициентов при  $T_{комп}$  и зависимости  $\gamma(T)$  для кристаллов группы № 3 (табл. 2). Как видно из табл. 2 и рис. 2, наибольшее значение  $\gamma$  соответствует кристаллам с закономерно-неоднородным распределением примеси. Это связано с тем, что пироэлектрический коэффициент при

постоянном механическом напряжении линейно зависит от униполярности  $k$  [12]

$$\gamma = \frac{\Delta P_s}{\Delta T} k.$$

Необходимо также отметить, что 120-часовой отжиг кристаллов TGS с неоднород-

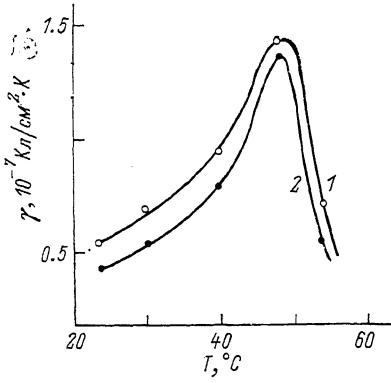


Рис. 2. Температурные зависимости  $\gamma$  кристаллов TGS с примесью  $L-\alpha$ -аланина группы № 3 (табл. 2), выращенных с изменяющейся по пилообразному закону скоростью роста (1), и контрольного кристалла, выращенного в статическом режиме (2).

ным распределением примеси при температуре  $60^\circ$  не изменил вида петли гистерезиса. В то же время у таких же контрольных кристаллов вид петли гистерезиса после отжига изменился от смещенной к двойной.

Закономерно-неоднородное распределение примеси в кристалле нами подтверждено косвенным образом. Установлено путем микроспектрофотометрирования, что концентрация примеси в полученных кристаллах при разной скорости роста различная. Так, наибольшее вхождение примеси в кристалл наблюдалось при росте кристалла в статическом режиме, а наименьшее — при росте кристалла с максимальной скоростью. Можно поэтому предположить, что в результате пилообразного изменения скорости роста примесь входит в кристалл соответствующим образом и в кристалле создаются слои с градиентом концентрации примеси. Градиент примеси в микрослое кристалла создает внутреннее смещающее поле, направленное вдоль градиента. Это внутреннее поле оказывает поляризующее действие на формирующуюся доменную структуру.

Наибольшее влияние неоднородное вхождение примеси оказало на TGS, допированный  $L-\alpha$ -аланином. По-видимому, это связано с различным механизмом возникновения  $E_{cm}$  в  $TGS + L-\alpha$ -аланин и  $TGS + Cr^{3+}$  [13]. Образование  $E_{cm}$  в TGS с  $L-\alpha$ -аланином происходит из-за возникновения необратимых диполей, имеющих некоторую степень полярности. При неравномерном градиентном распределении таких диполей в объеме кристалла могут возникнуть дополнительные внутренние поля, обусловленные неоднородным распределением этих диполей.

Таким образом, сравнивая полученные данные с известными из литературы, можно заключить, что униполярность сегнетоэлектрических кристаллов зависит от характера распределения примеси в объеме кристалла. Созданное в процессе выращивания кристаллов несимметричное, т. е. закономерно-неоднородное, распределение дефектов в их объеме может быть эффективным способом получения устойчивого униполярного состояния сегнетоэлектриков.

## Список литературы

- [1] Барфут Дж., Тейлор Дж. Полярные диэлектрики и их применения. М., 1981. 520 с.
- [2] Бородин В. З., Гах С. Г. // Изв. АН СССР, сер. физ. 1984. Т. 48. № 6. С. 1081—1085.
- [3] Новик В. К., Гаврилова Н. Д., Галстян Г. Т. // Кристаллография. 1983. Т. 28. № 6. С. 1165—1171.
- [4] Кудзин А. Ю., Юдин С. П., Панченко Т. В. // ФТТ. 1977. Т. 19. № 4. С. 1218—1220.
- [5] Nai-Beh Ming, Jing-Fen Hong, Duan Feng // J. Materials Science. 1982. V. 17. P. 1663—1670.
- [6] Лайнс М., Гласс А. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы. М., 1981. 720 с.
- [7] Rue K. L., Whipps P. W., Keve E. T. // Ferroelectrics. 1972. V. 4. P. 253—256.
- [8] Камышева Л. Н., Годованная О. К., Миловидова С. Д., Константинова В. П. // Изв. АН СССР, сер. физ. 1975. Т. 39. № 4. С. 857—860.
- [9] Didriksons G. T., Pfeiffer H. // Phys. Status Solidi. 1982. V. 71. N 1. P. 169—178.
- [10] Цедрик М. С. Физические свойства кристаллов семейства ТГС. Минск, 1986. 215 с.
- [11] Романюк Н. А., Желудев И. С. // Кристаллография. 1960. Т. 5. № 3. С. 403—408.
- [12] Совинов А. М., Гаврилова Н. Д., Новик В. К. // Изв. АН СССР, сер. физ. 1970. Т. 34. № 12. С. 2601—2603.
- [13] Галстян Г. Т., Рез И. С., Рейзер М. Ю. // ФТТ. 1982. Т. 24. № 7. С. 2186—2190.

Институт физики твердого тела  
и полупроводников АН Белорусси<sup>и</sup>  
Витебск

Поступило в Редакцию  
24 апреля 1991 г.